

2016年5月吉日

お客様各位

アルテック株式会社  
第2産業機械事業部  
先端機器営業部

### 「JPCA Show 2016」出展のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、弊社は、来たる6月1日(水)より6月3日(金)までの3日間、東京ビッグサイトにて開催される一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)主催の「JPCA Show 2016」に出展いたします。

本展示会では、ファインプロセス(微細加工)をテーマにナノインプリント原盤、スペクトロニクス社微細加工用ピコ秒ハイブリッドレーザー、OPTOMECH社エアロゾールジェット立体基板描画装置のパネル/サンプル展示並びにセルミック社超長作動焦点/超小型赤外線顕微鏡の実機によるデモを予定しています。

大変御忙しい折とは存じますが、皆様のご来場および弊社ブースへのお立ち寄りを心よりお待ちしております。何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

開催概要	
展示会名	「JPCA Show 2016」
会期	2016年6月1日(水)～6月3日(金) 3日間
開催時間	10:00～17:00 まで
会場/小間番号	東京ビッグサイト 東3ホール 3B-09
展示会 HP	<a href="http://www.jpca-show.com">http://www.jpca-show.com</a>

<お問い合わせ先>

アルテック株式会社

第2産業機械事業部 先端機器営業部

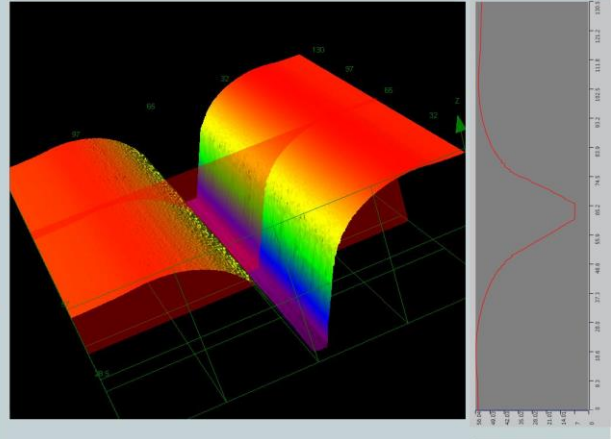
TEL :03-5542-6754 FAX :03-5542-6766

担当者: 大石 (oishi@altech.co.jp), 森田 (t-morita@altech.co.jp)

山根(yamane@altech.co.jp), 小林(k-kobayashi@altech.co.jp)

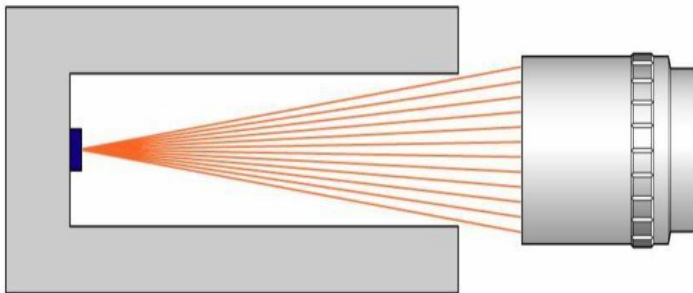
## 出 展 品 一 覧

＜スペクトロニクス社微細加工用ピコ秒ハイブリッドレーザー＞パネル・サンプル展示  
 新開発の高出力ハイブリッド型ピコ秒レーザーにて高速微細加工を実現



- 波長 266nm、355nm 532nm により超微細加工が可能
- パルス幅=50ps により高い加工速度を実現
- 非熱加工により酸化や熔融が抑えられる
- 短波長 & パルス幅を両立し、材料を分子レベルで分解(266nm)
- 低いランニングコスト(種レーザーの交換不要)

＜セルミック社超長作動焦点顕微鏡並びに超小型赤外線顕微鏡＞実機デモ展示  
 小型・高性能・低価格



—超長作動焦点顕微鏡—

近づけられないサンプルの高倍率観察を実現

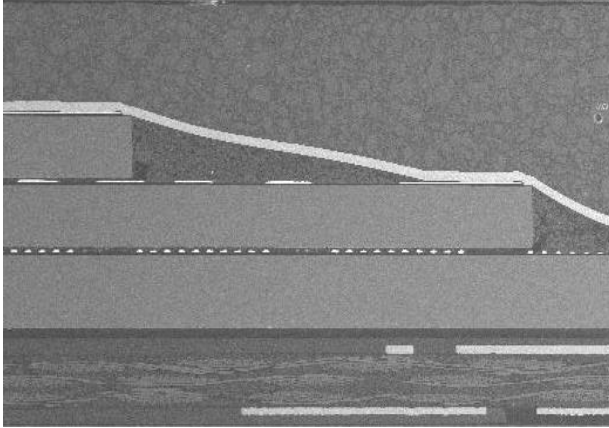
- 100 mm で 900 倍、500 mm でも 165 倍のモニター倍率を達成
- チャンバー内、高温試料、穴の中の観察が可能

—超小型赤外線顕微鏡—

- 可視光では不可能な表面から見えない内部配線の欠陥検査やシリコン・ガラスの接合用アライメントを観察することが可能

## 出 展 品 一 覧

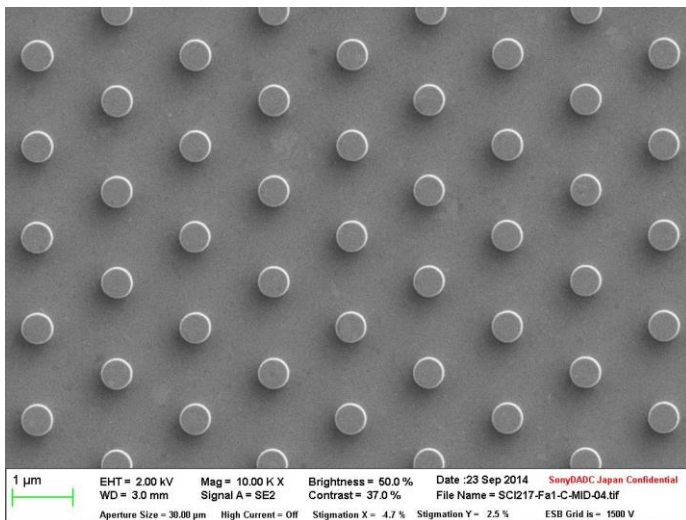
<OPTOMECC 社エアロゾールジェット立体基板描画装置>パネル・サンプル展示  
画期的な描画装置 立体基板への描画を実現



- 立体物へのダイレクト描画が可能
- 描画箇所外への材料飛散が少ない
- 電極形成に最適
- 粘度材料 ( $\leq 2500\text{cps}$ ) 対応

<微細パターン原盤>パネル・サンプル展示

レーザーで微細パターンを描画したニッケル原盤制作



- 最少 150nm のパターンを Ni に描画実現
- 最大アスペクト比(1:2)
- 低ランニングコスト(ライン・アンド・スペース、ポール、ピラー)